

## LCD/CVD 공정중에 발생하는 분진이 PFC 분해 촉매에 미치는 영향

권우정, 박용기, 최원춘\*, 김희영  
한국화학연구원  
(mrchoi@kriect.re.kr\*)

반도체 CVD 공정에서는 난분해성 PFC (CF<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>) 뿐만 아니라 분진이 발생한다. 본 연구에서는 이전에 700°C 이하에서 99% 이상 분해 처리할 수 있는 촉매를 개발하였으며, 촉매에 의한 여러 PFC 별 분해 특성 data의 확보와 분진에 의한 촉매의 영향을 연구하였다.